МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра материаловедения, технологии и управления качеством

СТАНДАРТЫ И АРТЕФАКТЫ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентаки 4 курса 4091 группы направления 22.03.01 «Материаловедения и технологии материалов», профиль «Нанотехнологии, диагностика и синтез современных материалов» института физики

Ивановой Анны Дмитриевны

Научный руководитель,		
доцент, к.фм.н., доцент		С.В. Стецюра
должность, уч. степень, уч. звание	подпись, дата	инициалы, фамилия
Зав. кафедрой,		
д.фм.н., профессор		С.Б. Вениг
должность, уч. степень, уч. звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

Введение. Атомно-силовая микроскопия (АСМ) широко используется при исследовании рельефа поверхности с разрешением до атомарного. Её можно использовать как на воздухе при атмосферном давлении, так и в жидкостях; можно изучать проводники и диэлектрики, полимерные материалы. Эти возможности АСМ позволяют в промышленных лабораториях диагностировать практически любой материал — измерения могут проводиться на участках сканирования от десятка нм до 150 мкм [1].

В современном мире нанотехнологии имеют большой вес во многих областях: в медицине, в машино-, авиа-, кораблестроении, при создании другой различной техники. И для контроля результатов нанотехнологий АСМ является одним из самых востребованных методов [2].

Целью выпускной квалификационной работы является на примере гибридных структур полупроводник — органическое покрытие с нанорельефной поверхностью показать возможности АСМ и провести анализ их морфологии с учетом возможных артефактов измерения.

На основе поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить с помощью учебно-методической и научной литературы физические принципы, режимы измерения ACM и проблемы, возникающие при сканировании;
- изучить возможности программного обеспечения Gwyddion для обработки изображений ACM;
 - изучить на практике оборудование для проведения АСМ измерений;
 - описать лабораторные образцы;
 - обработать сканы лабораторных образцов;
- проанализировать имеющиеся артефакты на обрабатываемых сканах,
 устранить артефакты;
- провести сравнительный анализ морфологии поверхности исследуемых образцов.

Дипломная работа занимает 49 страницы, имеет 32 рисунков и 3 таблицы. Обзор составлен по 26 информационным источникам. Во введение рассматривается актуальность работы, устанавливается цель и выдвигаются задачи для достижения поставленной цели.

Первый раздел представляет собой анализ научных и нормативных источников в области атомно-силовой микроскопии, описание режимов измерения АСМ и проблем, возникающих при сканировании.

Во втором разделе работы говорится о программе Gwyddion и её возможности в области устранения артефактов ACM изображений, содержится описание лабораторых образцов и микроскопа NANOEDUCATOR I компании НТ-МДТ (Москва, Зеленоград), с помощью которого исследовались образцы. Пятый пункт посвящен обработке полученных ACM изображений.

Основное содержание работы

Для проведения эксперимента использовали пластины монокристаллического Si кристаллографической ориентации (100) р-типа проводимости.

В качестве катионного полиэлектролита использовался полиэтиленимин (ПЭИ), который растворяли в воде и осаждали на Si в темноте в течение 10 минут. В качестве анионного полиэлектролита использовался фермент глюкозооксидаза (GOx, тип X-S от фирмы Sigma Aldrich), так как данный фермент широко используется как модельный при создании ферментных биосенсоров.

Молекулы GOx растворяли в деионизированной воде до концентрации 0.5мг/мл. Во время нанесения GOx один образец освещался белым светом высокой интенсивности в течение 60 минут при помощи галогенной лампы Philips 13186 EPX/EPV. У второго образца адсорбция GOx проходила в темноте так же в течении 60. минут. После адсорбции образцы промывались в деионизированной воде и сушились в потоке сухого воздуха.

На рисунке 1 представлено схематичная структура образца, изменяющаяся в процессе его изготовления.

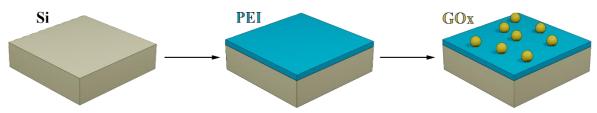


Рисунок 1 – Строение образца

Полученные образцы исследовали с помощью микроскопа NANOEDUCATOR I компании HT-МДТ (Москва, Зеленоград) в режиме атомно-силовой микроскопии (ACM). В полуконтактном режиме сканировались участки одинаковой площади.

NanoEducator I — это сканирующий зондовый микроскоп, который сочетает в себе простоту, устойчивость к случайным поломкам, низкую стоимость эксплуатации, возможность использовать в образовательном процессе и профессиональный функционал атомно-силового микроскопа.

На рисунке 2 показан внешний вид C3M NanoEducator I.

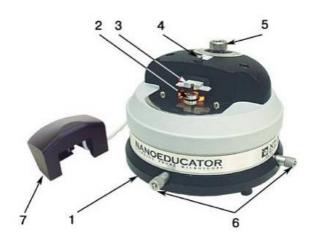


Рисунок 2 — Внешний вид измерительной головки СЗМ NanoEducator 1 — основание, 2 — держатель образца, 3 — Датчик взаимодействия, 4 — винт фиксации датчика, 5 — винт ручного подвода, 6 — винты перемещения сканера с образцом, 7 — защитная крышка с видеокамерой [3]

Для изображений, сделанных после сканирования микроскопами, им необходима обработка для избавления от артефактов. Для обработки используется программное обеспечение Gwyddion.

Gwyddion – это модульная программа анализа данных СЗМ. В первую очередь она предназначена для анализа полей высот, полученных различными

техниками сканирующей зондовой микроскопии (ACM, MCM, CTM, CБОМ), но в общем случае её можно использовать для анализа любых полей высот или изображений. Использующиеся инструменты: выравнивание, основные фильтры, статистический анализ [4].

На рисунке 3 изображены исходные и обработанные ACM изображения участков образца, выдержанного в темноте в течение 60 минут на время адсорбции GOx.

На рисунке 4 изображены исходные и обработанные ACM изображения участков образца, выдержанного при интенсивном освещении в течение 60 минут на время адсорбции GOx.

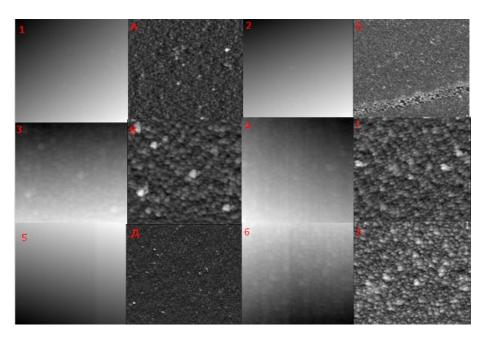


Рисунок 3 — Исходные ACM изображения структур p-Si/ПЭИ/GOx после нанесения слоя молекул Gox в темноте (1-6) и соответсвующие им обработанные изображения (A-E)

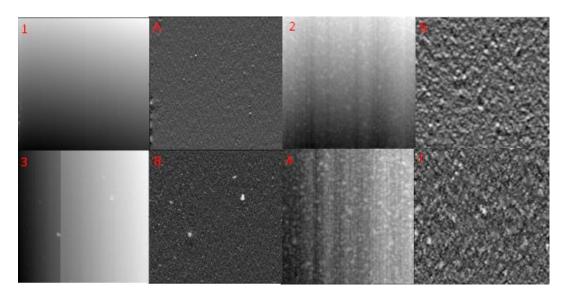


Рисунок 4 – Исходные АСМ изображения структур p-Si/ПЭИ/GOх после нанесения слоя молекул Goх при интенсивном освещении (1-4) и соответсвующие им обработанные изображения (A-Г)

Фрагменты 1-6 на рисунке 3 представляют собой разные области, отсканированные на одном и том же образце. Фрагменты 1-4 на рисунке 4 представляют собой разные области, отсканированные на одном и том же образце.

В таблицах 1, 2 представлены, полученные после обработки, результаты. Таблица 1 — Результаты для обработанных сканов изображения структур р-Si/ПЭИ/Gox после нанесения слоя молекул GOx в темноте

No॒	Число	Общая	Средняя	Средняя	Наиболее
скана	зёрен	площадь	высота	шероховатость	часто
		проекции(отн),	неровностей,	поверхности,	встречающееся
		%	НМ	НМ	значения
					высоты
1	264	3, 957	3,92	0,924	3,95
2	135	7,733	3,51	0,895	3,2
3	543	6,813	8,5	1,039	5,5
4	149	3,431	3,42	0,917	3,25
5	133	0,731	3,12	0,984	2,66
6	115	2,709	4,16	1,383	3,5

Таблица 2 — Результаты для обработанных сканов изображения структур р-Si/ПЭИ/Gox после нанесения слоя молекул GOx при интенсивном освещении

№	Число	Общая	Средняя	Средняя	Наиболее
скана	зёрен	площадь	высота	шероховатость	часто
		проекции(отн),	неровностей,	поверхности,	встречающееся
		%	HM	НМ	значения
					высоты
1	64	0,146	7,37	1,220	6,97
2	40	0,584	4,38	1,094	3,98
3	46	0,380	4,85	1,321	4,06
4	36	0,473	4,23	1,097	3,88

По данным таблицы 1 среднее число зерен для данной группы сканов составляет 223. Диапазон наиболее часто встречающихся значений высот составяляет 3,2-5,5 нм.

По данным таблицы 2 среднее число зерен для данной группы сканов составляет 46. Диапазон наиболее часто встречающихся значений высот составялет 3,88-6,97 нм.

Из приведенных выше данных видно, что освещение уменьшает число адсорбированных на p-Si молекул GOx в среднем больше, чем в 4 раза.

На рисунке 5 изображена диаграмма сравнения числа адсорбированных на p-Si молекул GOx в темноте и при освещении.

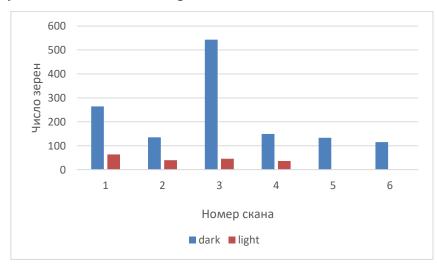


Рисунок 5 — Число адсорбированных на p-Si молекул GOx

Заключение. В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были получены следующие основные результаты и сделаны выводы:

- изучены межгосударственные и национальные стандарты в области атомно-силовой микроскопии. Сделан вывод о том, что первоочередное внимание уделяется описанию рельефных мер нанометрового диапазона, методике калибровки и методике измерений эффективной высоты шероховатости поверхности с помощью атомно-силовых микроскопов. Это вызвано тем, что при измерениях возможно проявление различных артефактов, требующих устранений.
- в результате сканирования при помощи ACM образца зондом получается изображение рельефа образца, искажённое артефактами, причинами которых может быть неидеальность сканера, ошибки при установке образца в оборудование, внешние причины;
- программное обеспечение для обработки изображений ACM помогает понять природу артефактов и исправить их;
- были обработаны ACM-изображения образцов структур p-Si/ПЭИ/Gox, адсорбция GOx на первом образце проходила при освещении Si белым светом высокой интенсивности в течении 60 минут, второго в темноте так же в течении 60 минут. Были обнаружены и устранены такие артефакты, как периодически повторяющиеся помехи, наклон изображения и двойственность изображения.
- с помощью программного обеспечения Gwyddion были получены данные о шероховатости поверхности указанных образцов, высоте неровностей, степени покрытия поверхности молекулами GOx (в процентах относительно площади скана) и числе адсорбированных на p-Si молекул Gox.
- сделан вывод о том, что освещение p-Si во время адсорбции глюкозооксидазы существенно уменьшает число адсорбированных на p-Si молекул Gox (более, чем в 4 раза).

Список использованных источников

1 Андреева, Н. В. Экспериментальные методы исследования. Методики тунельной и атомно-силовой микроскопии : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. Андреева, [и др]. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – 104 с.

2 Дроздов, О. И. Сканирующая зондовая микроскопия в нанометрологии / О. И. Дроздов, [и др]. // Современные материалы, техника и технологии. — 2019. — № 2 (23). — С. 91-97.

3 Сканирующий зондовый микроскоп NanoEducator [Электронный ресурс] // Руководство пользователя HT-MДТ [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: http://lab2.phys.spbu.ru/nano/images/nanoeducator.pdf/ (дата обращения: 16.03.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

4 Руководство пользователя Gwyddion [Электронный ресурс] // Gwyddion.net [Электронный ресурс] : [сайт]. — URL: http://gwyddion.net/download/user-guide/gwyddion-user-guide-ru.pdf (дата обращения: 26.03.2022). — Загл. с экрана. — Яз. рус.